【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】令和4年11月16日(2022.11.16)

【国際公開番号】WO2022/049980
【出願番号】特願2022-546181(P2022-546181)
【国際特許分類】
Ｆ２７Ｄ　3/12(2006.01)
Ｃ０４Ｂ 35/01(2006.01)
【ＦＩ】
Ｆ２７Ｄ　3/12　　Ｓ
Ｃ０４Ｂ 35/01

【手続補正書】
【提出日】令和4年9月5日(2022.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミックス質の基材と、
基材表面を被覆しており、被膜厚みが１μｍ以上２０μｍ以下であり、表面粗さＲａが１μｍ以下である被膜層と、を有し、
被膜層の厚みばらつきが、被膜厚みの４０％以下であるとともに、被膜厚みの±３μｍである焼成用セッター。
【請求項２】
被膜層が、基材表面を被覆している複数の被膜片を含んでおり、
各被膜片の間に、５μｍ以上５０μｍ以下の隙間が設けられている請求項１に記載の焼成用セッター。
【請求項３】
被膜片が、円形または多角形の所定形状であり、基材の表面に規則的に出現している請求項２に記載の焼成用セッター。
【請求項４】
各々の被膜片の表面に、第２の被膜片が設けられており、
被膜片間の間隔が、第２の被膜片間の間隔と異なる請求項２または３に記載の焼成用セッター。
【請求項５】
被膜層の材料が、ＺｒＯ２／Ｙ２Ｏ３、ＺｒＯ２／ＣａＯ、Ｙ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ムライト、または、それらの材料の混合物を含む請求項１から４のいずれか一項に記載の焼成用セッター。
【請求項６】
前記基材の材料が、ＳｉＣ質である請求項１から５のいずれか一項に記載の焼成用セッター。
【請求項７】
被膜層が、２層以上の多層構造を有している請求項１から６のいずれか一項に記載の焼成用セッター。
【請求項８】
被膜層の気孔率が、５％以上５０％以下である請求項１から７のいずれか一項に記載の

焼成用セッター。
【請求項９】
セラミックス質の基材と、基材表面を被覆しているとともに被膜厚みが１μｍ以上２０μｍ以下である被膜層と、を有する焼成用セッターの製造方法であって、
前記基材の表面に被膜層形成用ペーストを印刷し、基材表面に被膜層形成用塗膜が設けられた成形体を作製する工程を有する、製造方法。